

除了增加面積可改善匹配之外，能將參數有平均效果的方法如電晶體疊接或加入模仿單元都可改善匹配的問題，如圖 25 所示，對於寬電晶體而言，每個電晶體可能使用兩個或是更多的指狀結構來改善匹配現象。

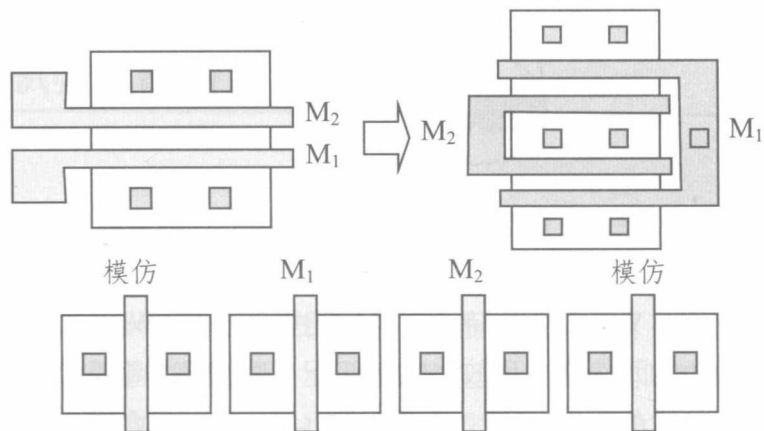


圖 10-25 對稱／疊接電晶體與加入模仿單元以改善匹配現象。

高精確電路設計之電容佈線亦須遵循上述對於電晶體和電阻所描述的匹配原則，舉例來說，在需要一個良好匹配電容陣列之應用中，模仿元件必須放置於陣列的周圍。注意對稱必須被加入我們所注意的元件和其週遭環境是很重要的。

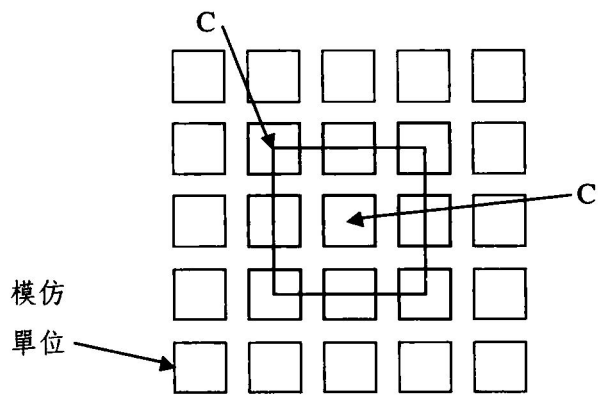


圖 10-26 加入模仿電容元件以改善對稱性。